

气相化学沉积设备价格 沈阳鹏程 气相化学沉积设备

产品名称	气相化学沉积设备价格 沈阳鹏程 气相化学沉积设备
公司名称	沈阳鹏程真空技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈河区凌云街35号
联系电话	13898863716

产品详情

ICP刻蚀机的测量与控制

沈阳鹏程真空技术有限责任公司生产、销售ICP刻蚀机，以下信息由沈阳鹏程真空技术有限责任公司为您提供。

由于等离子刻蚀工艺中的过程变量，如刻蚀率、气压、温度、等离子阻抗，气相化学沉积设备，等等，不易测量，因此业界常用的测量方法有：

虚拟测量 (Virtual Metrology)

等离子刻蚀过程控制示意图

光谱测量

等离子阻抗监控

终端探测

远程耦合传感

控制方法

run-to-run 控制 (R2R)

模型预测控制 (MPC)

化学气相沉积过程介绍

化学气相沉积过程分为三个重要阶段：反应气体向基体表面扩散、反应气体吸附于基体表面、在基体表面上发生化学反应形成固态沉积物及产生的气相副产物脱离基体表面。常见的化学气相沉积反应有：热分解反应、化学合成反应和化学传输反应等。通常沉积TiC或TiN，是向850~1100 的反应室通入TiCl₄，气相化学沉积设备价格，H₂，CH₄等气体，气相化学沉积设备报价，经化学反应，在基体表面形成覆层。

沈阳鹏程真空技术有限责任公司以诚信为首，气相化学沉积设备多少钱，服务至上为宗旨。公司生产、销售化学气相沉积，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

化学气相沉积法在金属材料方面的使用

沈阳鹏程真空技术有限责任公司生产、销售化学气相沉积，以下信息由沈阳鹏程真空技术有限责任公司为您提供。

化学气相沉积法生产金属铱高温涂层从20世纪80年代起，NASA 开始尝试使用金属有机化合物化学气相沉积法制取出使用铱基铱作为涂层的复合喷管，并获得了成功，这时化学气相沉积法在生产金属涂层领域才有了一定程度上的突破。

NASA 使用了C₁₅H₂₁IrO₆作为制取铱涂层的材料，并利用C₁₅H₂₁IrO₆的热分解反应进行沉积。铱的沉积速度很快，可以达到3~20 μ m/h。沉积厚度也达到了50 μ m，C₁₅H₂₁IrO₆的制取效率达 70%以上。

气相化学沉积设备价格-沈阳鹏程(在线咨询)-气相化学沉积设备由沈阳鹏程真空技术有限责任公司提供。沈阳鹏程真空技术有限责任公司是一家从事“电阻热蒸发镀膜，磁控溅射，激光脉冲沉积，电子束”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鹏程真空”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使沈阳鹏程在成型设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！